

経済産業大臣

菅 原 一 秀 殿

一般社団法人日本半導体製造装置協会
会 長 牛 田 一 雄

税制改正に関する要望書

わが国の経済は、2012 年 12 月の安倍政権発足以来のアベノミクス推進のもと、緩やかな成長が続いて参りました。2018 年 7-9 月期は自然災害が相次ぎ一旦実質 GDP 成長率はマイナスへ転じましたが、2018 年 10-12 月期以降はプラス基調を維持し 2019 年 4-6 月期の GDP 成長率速報値は年率換算で 1.8%増となりました。一方、他国においては米国商務省発表の 4-6 月期実質 GDP 成長率は 2.1%(年率換算)と 1-3 月(3.1%)より減速。中国国家统计局発表の 4-6 月期実質 GDP 成長率も 6.2%(年率換算)と 1-3 月(6.4%)より減速しています。

米中の貿易摩擦深刻化による影響は徐々に顕在化しており、分野によっては設備投資を先送りする傾向も出始めております。米国による第 4 弾の対中追加関税制裁や、中国に対する為替操作国認定の発表により、問題の早期解決が難しくなってきたとの懸念も高まっております。

半導体・FPD 製造装置業界を取り巻く環境は、昨年より半導体メモリーを中心とした価格の下落が続いており、設備投資も減速傾向が続いております。本年度の日本製半導体製造装置販売高は前年度比で 11%下落、FPD 製造装置は前年比実質 16%の下落(当協会推定)を見込んでおります。

一方で、半導体産業そのものは、過去の PC やスマートフォン向け需要に大きく依存する形から、IoT、データセンター、5G、ADAS/自動運転、人口知能(AI)、ロボットといった新たな需要が、重層的に設備投資を牽引する形へと、大きく変化しております。中長期的には高い成長が見込まれるという見方は、何ら変わっておりません。

世界中の企業がこの有望な市場獲得を目指して参入しており、各国間の競争も更に峻烈さを極めております。現在日本製半導体・FPD 製造装置の世界シェアは 3 割を超えており、殆ど国内に生産拠点を有し、国内の雇用を維持しながら、輸出比率 8 割を達成しております。当業界は技術革新進歩が著しい産業であり、これからも日本企業がグローバル競争に打ち勝つためには、絶え間ない最先端技術の研究・開発によるイノベーションの創出が必要不可欠です。

政府より 6 月に発表された「成長戦略実行計画」における「Society 5.0 の実現」には、データ流通の安全性確保と活性化、5G 時代の高度ネットワークの確保と新たなビジネスの創出が謳われております。「成長戦略実行計画」に沿う形で日本経済を持続的に発展させるためにも、国内を中心に雇用を行い国内で生産活動を行なっている日本企業が海外企業とのグローバル競争に勝ち抜いてゆくことが重要です。

わが国でも法人実効税率の引下げが行われていますが、米国やフランス等も税率を下げています。相対的な競争環境は改善していません。半導体製造装置の世界シェアは、米国と日本を除くとオランダと韓国が高く、両国とは法人実効税率やその他の税制優遇面では、まだ大きな開きがあります。

「成長戦略実行計画」を更に推進し実現性を高めてゆくためにも、次に掲げる税制の整備を強く要望致します。

1. 研究開発促進税制の拡充と見直し

半導体・FPD 製造装置産業の売上高研究開発費率は 8.8 %^{※1} と、全産業平均の 4.17%^{※2}、製造業平均の 5.02%^{※2} と比較して約 2 倍もの研究開発費を投じています。海外競合企業の売上高研究開発費率も 15%^{※3} となっており研究開発費比率が非常に高い産業と言えます。

半導体・FPD 製造装置産業が支える、半導体及び FPD、それらを用いた IT・エレクトロニクス産業は「第 4 次産業革命 (IoT・ビッグデータ・AI)」を推進する重要な産業であり、日本の他産業の発展にも大きな影響を及ぼしています。

当産業の研究開発費は、半導体や FPD のさらなる微細化・高精細化、ウエハやガラスプレート基板の大型化等のニーズに応えるために一層巨額となってゆく傾向にあります。こうした状況下において、当産業が必要十分な研究開発費を投じて成長し、同時に他産業の発展を促進してゆくことは、わが国が注力すべき次の課題に照らしても必須と考えます。

- ①IoT、ビッグデータ、AI の活用によるものづくり革命「第 4 次産業革命」の推進
- ②次世代自動車、次世代交通システム、先端ロボット、IT 機器、次世代デバイス等の最先端の製品の競争力向上
- ③低消費電力化やスマートグリッド等によるグリーン・イノベーションの推進
- ④先進的医療機器、医療のデジタル革命、医療・健康データ活用による世界最先端の健康立国の実現
- ⑤国民・社会を守る世界最高水準の通信インフラの整備
- ⑥イノベーション創出・チャレンジ精神に溢れる人材の創出による技術立国・知財立国日本の再興

こうした当産業における研究開発費の状況とその果たす役割を踏まえて、次の措置を要望します。

※1 当協会の 2019 年 7 月調査による SEAJ 会員企業主要 16 社の 2014～2018 年度の 5 年間の平均

※2 出所：経済産業省「平成 30 年企業活動基本調査確報 (平成 29 年度実績)」

※3 当協会の 2019 年 7 月調査による海外競合企業主要 5 社の 2014～2018 年度の 5 年間の平均

(1) 試験研究費の税額控除割合の拡大及び税額控除限度額の廃止

当産業の研究開発費が多額であること、それによってもたらされる産業全体の成長とイノベーションが国益にもたらす影響を踏まえ、現在の試験研究費の税額控除制度における税額控除割合の拡大と控除限度額の廃止を同時に実現することを要望します。当産業の税額控除限度額の切捨て額は 139 億円^{※4}にのぼり、これは

当産業の法人税額 1,191 億円^{※5}の約 12%に相当する額となります。

上記の通り、法人税額に対する税額控除の割合は十分な割合とは言えないため、さらなる税額控除割合の拡大並びに税額控除限度枠のさらなる引き上げ、更には限度枠の廃止を要望します。加えて、研究開発税制は成長戦略の重要な政策税制であるため、租税特別措置法による時限的措置ではなく、本来、本則化による恒久的措置とすべきと考えます。

※4 当協会の 2019 年 7 月調査による SEAJ 会員企業主要 16 社の 2014～2018 年度の 5 年間の平均

※5 当協会の 2019 年 7 月調査による SEAJ 会員企業主要 16 社の 2014～2018 年度の 5 年間の平均

(2) 繰越税額控除限度超過額等の繰越期間の復活及び繰越税額控除要件の廃止

当産業の業績は、顧客である半導体・FPD メーカーの急激な投資動向の変化による振れ幅が大きく、かつそのサイクルも長期にわたるケースが多くあります。平成 27 年度に廃止された試験研究費の税額控除制度におきましては、繰越税額控除限度超過額がある場合、一定期間に限ってのみ繰越控除が認められていましたが、廃止された現行制度下においては、超過額に対する恩恵を受けることができなくなっております。また、廃止前の制度の下であっても、当該事業年度に所得がないために本制度の恩恵を受けられないケースが生じておりました。

つきましては、まずは本制度の復活を要望します。加えて、諸外国の同制度が主に複数年～無期限であることに鑑み、繰越税額控除限度超過額等の繰越期間を無期限とし、併せて繰越控除を行う際の従来の控除要件は廃止することを要望します。

(3) サービス開発税制の拡充

当産業においては、半導体製造における生産リードタイムの短縮や納入した製造装置の異常予測など、製造装置から得られる様々なデータを計測、解析することにより実現可能となる機能やサービスの開発の重要性が急速に高まっております。またこれらの機能やサービスは、国内企業の国際競争力の維持・強化のためにも非常に重要な要素となっております。

これらの IoT、ビッグデータ、AI を活用した機能やサービスに関して、顧客から対価を得て販売するケースだけでなく、その機能を社内で利用することにより、販売する企業側の業務効率の改善や原価低減の実現等の便益を享受できるケースは多くあります。

つきましては「対価を得て」行う開発のみならず、顧客に無償で提供する場合や自社のみで利用する場合といったより高度なサービスの機能開発についても、サービス開発としての条件を満たすこととするよう要望します。

また、対象となる人件費の範囲につきましても、センサーの設置等を行う補助者の人件費に関しては対象に含まれないとされておりますが、これらの作業は開発過程において必須であるケースが多いことを鑑み、補助者に係る人件費についても対象範囲に含めることとするよう要望します。

(4) イノベーションボックス税制の創設

研究開発の成果である特許などの知的財産に基づく所得を減税対象とするイノベーションボックス税制が欧州を中心に普及し始めています。

既にEUにおいては、英国、オランダ、フランス等7カ国が、アジアにおいては中国がイノベーションの促進及び競争力向上を目的として、研究開発の成果である知的財産権から生じる所得に対する税率を優遇するイノベーションボックスまたはパテントボックス税制を導入しています。

一例として本税制を積極的に導入・推進するオランダでは、2004年に29.0%であった法人税率を2011年までに段階的に25.0%に引き下げる措置と併せて、2010年に従来のパテントボックス税制をイノベーションボックス税制へと拡大しています。これにより、研究開発活動による知的財産から生じた所得については法人税の計算上5%の軽減税率の適用を選択することを可能としています。

同国に本社を置く半導体製造装置のメーカーであるASML社の2014年度から2018年度の法人税率は平均10.9%と極めて低く^{※6}、イノベーションボックス税制の恩恵を最大限受けております。

海外企業と同じビジネス環境で熾烈な競争を戦えるよう、わが国においてもイノベーションボックス税制をできる限り早期に導入することを要望します。

※6 ASML社決算報告書による2014～2018年度の5年間の平均

2. 法人実効税率の引下げ

わが国の法人実効税率は、平成28年度税制改正により平成27年度の33.06%から、平成28年度及び平成29年度は30.86%、平成30年度以降は30.62%へ引き下げられました^{※7}、依然として欧州及びアジア諸国に比べて高い水準にあります。

しかしながら、法人税率の引き下げが実施されている一方、平成28年度税制改正において地方税である外形標準課税は税率の引き上げが実施され、外形標準課税の割合が大きい企業や赤字企業等においては法人事業税が増税となり、実質増税となる企業も少なからずあるのも事実です。

わが国と事業及び立地において競争関係にあるアジア諸国と比較すると、中国25%、韓国24.2%、シンガポール及び台湾17%と5～10%以上の乖離があり、日本の企業競争力及び立地競争力低下の大きな要因になっており、世界で戦う日本企業が継続的に存続することは困難です。

立地競争力強化のためには、空港・港湾等の産業インフラの整備、金融・資本市場の活性化、雇用制度の改革、人材強化等の総合的な施策が必要ですが、法人実効税率の引き下げの果たす役割は特に重要です。

従って、現在懸念されている「根こそぎ空洞化」を防止するに留まらず、より積極的に海外の成長力ある企業がわが国を拠点とした事業活動を行うことを希求する水準への思い切った引き下げが必要です。

具体的には、法人実効税率をアジア諸国と競争力のある水準である20%前半まで、3年以内に引き下げること及び外形標準の税率を改正前に戻すことを要望します。

3. 欠損金の控除限度額の撤廃及び繰越期間の無期限化

法人税における欠損金の繰越控除制度は、事業年度課税制度の欠点を是正し、公平な課税を図るための措置であり、事業年度ごとの課税負担の平準化を通じて経営の中長期的な安定性を確保するものであるため、わが国企業の投資意欲や競争力を高めるうえで極めて重要な制度であるから本来制限を設けるべきではないと考えます。

また当産業の特徴として、顧客である半導体・FPD メーカーの投資動向の影響を受けやすく、業績の波が激しい事に加え、景気後退期には比較的大きな損失を計上する傾向があるため、欠損金の繰越控除については十分な措置を設ける必要があります。

しかしながら、欠損金の繰越期間は10年、また当期の控除額も所得の50%に制限され、わが国の欠損金に関する制度は、諸外国に比べて見劣りのするもので、近年の税制改正を経てその差は拡大し、グローバル企業と熾烈な競争を続けている当産業にとっても国際競争力維持の観点からも障害となっております。

従って欠損金の繰越控除制度について、控除限度額を撤廃した上で繰越期間を無期限とすることを要望致します。

4. 設備投資に関する減税及び資産課税制度の見直し

(1) 設備投資に関する減税

当産業では、半導体・FPDの微細化やウエハ・基板の大型化に対応するために多額かつ継続的な設備投資が必要であり、また、当産業の顧客である半導体及びFPDメーカーも、より付加価値の高いデバイスを製造していくための設備投資が不可欠なものとなっています。

加えて、国内の当産業は、海外企業との熾烈な競争に勝ち残るため、世界最高レベルの技術水準を維持し、かつグリーン・イノベーションの推進にも貢献していくことが求められています。

しかしながら、現在導入されている「コネクテッド・インダストリーズ税制」は、計画の認定要件として、生産性向上に加え、データ連携・利活用 および サイバーセキュリティ対策の要件が必須となっており、一方で、平成29年3月末に廃止となった旧制度「生産性向上設備投資促進税制」については、企業の生産設備の大半が生産性向上を目的とした投資であることから、当該優遇税制は適用範囲が広く、企業にとって非常に使い勝手の良い税制であったと考えております。つきましては、旧制度「生産性向上設備投資促進税制」を復活させると共に、今後の投資促進税制の設定におかれましては、利便性の向上を踏まえた適用要件であること、また手続きが煩雑という理由により利用を断念する事例が散見されたため、今後は極力簡素な手続きで利用できる制度になることを要望します。

(2) 固定資産税（償却資産）の見直し

わが国の償却資産に関わる固定資産税が国際的に見ても希な制度（特に当業界にとって競争が著しい韓国、中国には当制度は存在しない）であることを踏まえ、その速やかな縮減・廃止を要望します。

少なくとも、耐用年数の短い動産は、原材料・水道光熱費等の経費と同様、製品・部品を製造するために費消される投入原価要素であり、固定資産税の課税対象にはなじまないことから、課税対象から除外すべきと考えます。

また、圧縮記帳・特別償却・割増償却など国税の申告では認められる制度が固定資産税（償却資産）では認められない、一括償却資産は固定資産税（償却資産）の対象外となるにもかかわらず少額減価償却資産は対象となる、など国税においては民間投資の刺激を目的とした税務上の恩典があるにもかかわらず、地方税においては税収の確保だけに重きを置いているように見受けられます。グローバル競争に勝ち抜いてゆくためにも、国だけでなく地方単位での優遇税制の実施を強く望みます。

5. 国際関連税制の見直し

(1) 移転価格税制の改善

移転価格調査の課税手法は取引単位営業利益法（TNMM）が一般的であるが、明確な数値が無く、企業側は法令違反を行っている訳では無いのに、当局による移転価格課税が行われる例が多くみられます。つきましては、国別業種別等の具体的な数値・基準等を法令等で明記して頂く事を要望します。

(2) 外国税額控除の条件緩和

企業活動がグローバルに展開される中で、二重課税の排除は可能な限り許容されるべきであります。当産業の企業の多くは海外に現地法人を設立し当該国/地域で活動を展開しておりますが、技術進歩が速いため国内からの人員派遣や設備貸与が不可欠となっております。日本企業がこれらの活動を通して現地で得る役務所得や設備使用料等は現地で源泉徴収課税された後に、現地法人や顧客から回収されますが、これら外国での課税額についての日本での外国税額控除の条件を見直し緩和することにより、企業のグローバルな活動促進が期待されます。

現行税制で3年間となっている控除限度超過額と控除余裕額の繰越期間を延長するとともに、繰越期間経過後の控除限度超過額を損金算入可能とする条件緩和により、二重課税の排除が拡大されることを要望します。

以上